【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成20年1月17日(2008.1.17)

【公開番号】特開2006-156554(P2006-156554A)
【公開日】平成18年6月15日(2006.6.15)
【年通号数】公開・登録公報2006-023
【出願番号】特願2004-342251(P2004-342251)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　21/027　(2006.01)
Ｆ１６Ｃ　29/02　(2006.01)
Ｆ１６Ｃ　32/06　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/68　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　21/30　５０３Ａ
Ｆ１６Ｃ　29/02
Ｆ１６Ｃ　32/06　Ａ
Ｈ０１Ｌ　21/68　Ｋ
Ｈ０１Ｌ　21/30　５１５Ｇ

【手続補正書】
【提出日】平成19年11月21日(2007.11.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のステージが定盤上で移動するステージ装置であって、
前記定盤は、隙間を介して隣接して配置された複数の定盤を有し、
各ステージは、前記定盤と対向する面に複数の気体軸受部を有し、
前記複数の気体軸受部の一部が前記隙間に位置するときに、他の部分が前記隙間に位置しないように配置されていることを特徴とするステージ装置。
【請求項２】
前記ステージを定盤上で駆動する平面モータを備えることを特徴とする請求項１にステージ装置。
【請求項３】
前記複数の気体軸受部は、前記定盤が隣接する方向に離間して配置されていることを特徴とする請求項１または２に記載のステージ装置。
【請求項４】
前記複数の気体軸受部は、前記定盤が隣接する方向を長手方向とすることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載のステージ装置。
【請求項５】
前記離間して配置された気体軸受部は、それぞれ気体を供給するための気体供給孔と、前記気体供給孔の周囲に配置された溝を有することを特徴とする請求項３または４に記載のステージ装置。
【請求項６】
前記複数の気体軸受部は各ステージの重心位置に対して均等に配置されていることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載のステージ装置。

【請求項７】
請求項１乃至６のいずれかに記載のステージ装置であって、
前記複数のステージは２つのステージであり、
前記複数の定盤は前記２つのステージの一方に第１の処理を行うために利用される第１定盤と、他方に第２の処理を行うために利用される第２定盤と、を備え、前記２つのステージは第１および第２定盤間で入れ換え可能に構成されることを特徴とするステージ装置。
【請求項８】
パターンを基板に露光する露光装置であって、
請求項１乃至７のいずれかに記載のステージ装置を用いて、基板をパターンに位置決めして露光することを特徴とする露光装置。
【請求項９】
請求項８に記載の露光装置を用いてウエハを露光する工程と、
前記ウエハを現像する工程とを備えることを特徴とするデバイス製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
上述の目的を達成するために本発明では、複数のステージが定盤上で移動するステージ装置であって、前記定盤は、隙間を介して隣接して配置された複数の定盤を有し、各ステージは、前記定盤と対向する面に複数の気体軸受部を有し、前記複数の気体軸受部の一部が前記隙間に位置するときに、他の部分が前記隙間に位置しないように配置されていることを特徴としている。